

◆◇◆ プログラム ◆◇◆

13:30~13:35 開会挨拶 NBCI ビジネス委員会 委員長 佐野 睦典

(1) 【講演・発表】

13:35~14:20

基調講演：「ナノエレクトロニクス関連のロードマップと環境・エネルギーへの貢献」

講師：NBCIテクノロジー委員会・エレクトロニクス分科会 主査 芝 健夫 氏
(日立製作所 中央研究所 研究主幹)

[講演概要] NBCI のテクノロジー委員会では、ナノテクノロジーと製品との関連を分かり易い形でまとめたロードマップを、産業界の主な分野で作成し、毎年更新を行っている。最近では、これらのロードマップをさらに魅力あるものにするため、ナノテクノロジーとそれが生み出す製品の、環境・エネルギーへの貢献がわかるようにロードマップをまとめ直し、展示会やセミナーの場を借りて報告している。本日はこれらのロードマップの中から、本日の発表内容に関連するナノエレクトロニクス分野のロードマップをいくつか取り上げて、概要を紹介する。

14:20~14:50

株式会社 SNT 「ウェットプロセスナノコーティングによる 透明導電膜と光制御」

発表者：研究開発部 主任研究員 堀田 芳生 氏

[発表概要] 省エネ、環境保全、エコ重視の新規薄膜技術をご紹介します。新世代薄膜製造技術「交互吸着法」は、水を用いた安心・安全なウェットプロセスナノコーティングです。弊社 SNT では、この製膜技術を原理としたナノフィルムメーカー(Nano Film Maker)を開発し、販売しております。常温・常圧でナノスケールの精度を維持してコーティングできるので、大面積の薄膜作製を可能にします。また、ロール to ロールの製造方法、装置に関して特許を取得しております。ナノフィルムメーカーは、様々な機能性薄膜の開発を支援するツールです。透明導電膜や反射防止膜、防曇膜、光フィルタなど機能性薄膜を、従来の真空薄膜製造技術の100分の1のコストでの実現が期待されています。

[発表目的] 装置販売、共同研究、受託研究、ニーズ探索

14:50~15:20

株式会社 クレステック 「MEMS/NEMS生産用電子ビーム(EB)ステッパーの開発」

発表者：技術本部 開発部 小島 明 氏

[発表概要] 本開発は、光ステッパーでは原理的に困難となる高解像度と深いフォーカスマージンの両立を一括EB露光によって実現し、次世代MEMS/NEMSである、複合化MEMSやMEMS+LSI素子の開発および製作で必要となる100nm レベル解像度・高スループットのEBステッパーを供給することを目的としている。発表では、パターン化されたナノシリコン弾道電子面放出素子を電子源とする等倍一括EB露光実験の現況と、開発中のEBステッパー試作機の概要について説明する。

[発表目的] 弊社MEMS生産装置開発のPR

15:20~15:30 休憩

15:30~16:00

株式会社 協同インターナショナル 「微細薄膜受託加工 事業内容のご紹介」

発表者：電子部 丸岡 聡 氏

[発表概要] 成膜加工(スパッタ、CVD、蒸着)～パターンニング、CMP、ダイシングと半導体の前工程を一貫してお届けいたします。特にスパッタ加工においては、CVD 酸化膜と同等の絶縁性を持つ特殊な薄膜品をご提供いたします。また、本技術を用いて、MEMS デバイスの受託加工も行っております。ナノインプリント用モールド作製&インプリント受託加工も行っており、微細薄膜加工全般を広くサポートいたします。

[発表目的] 受託加工拡販、協業先探索、共同研究 他

16:00~16:30

ナノ・ミール 株式会社(光産業創成大学院大学) 『「コロイド系フォトニック結晶」と「紫外線技術」』

発表者：代表取締役 内山 昌一 氏

[発表概要] ナノ・ミール社の得意とする「コロイド系フォトニック結晶」とその可能性について紹介する。さらに、得意とする「紫外線技術(特に受光素子)」についても紹介する。

[発表目的] ニーズ探索、共同研究 他

(2) 【ポスターセッション】

16:30~17:30

発表企業4社によるポスターセッションを行います。同会場にて。

発表者と参加者と、個別に情報交換・名刺交換・ビジネスマッチングを行なっていただけます。

